

Auf der Basis langjähriger Erfahrung mit Sputterprozessen untersucht das ZSW Sputtertargets (z.B. $\text{ZnO}:\text{Al}_2\text{O}_3$ -Targets) für den industriellen Einsatz. Die Targets werden auf standardisierte Weise eingesputtert und bis zu hohen Leistungen geprüft. Die Sputtertauglichkeit wird anhand der Neigung zu Arcs, der Targetverpickelung und der erreichbaren Schichtqualität überprüft. In Absprache mit dem Kunden führt das ZSW Parametervariationen beim Sputterprozess (Druck, Leistung etc.) durch und charakterisiert die fertigen Schichten. Auf Wunsch werden die Schichten auch in kompletten Schichtsystemen, wie z.B. in CIS-Solarzellen, untersucht.

Anforderungen

Targets auf Typ PK500-Kathode (488 mm x 88 mm)

Dual-Magnetron-Anordnung für reaktive Abscheidung

